



(19)中華民國智慧財產局

(12)設計說明書公告本

(11)證書號數：TW D236040 S

(45)公告日：中華民國 114 (2025) 年 01 月 21 日

(21)申請案號：112303020

(22)申請日：中華民國 112 (2023) 年 06 月 16 日

(51)LOC.(13)Cl.：15-99

(30)優先權：2023/01/25 日本

2023-001109

(71)申請人：日商國際電氣股份有限公司(日本) KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION (JP)
日本

(72)設計人：西本英幸 NISHIMOTO, HIDEYUKI (JP)

(74)代理人：林志剛

(56)參考文獻：

TW D120457

JP D1727812

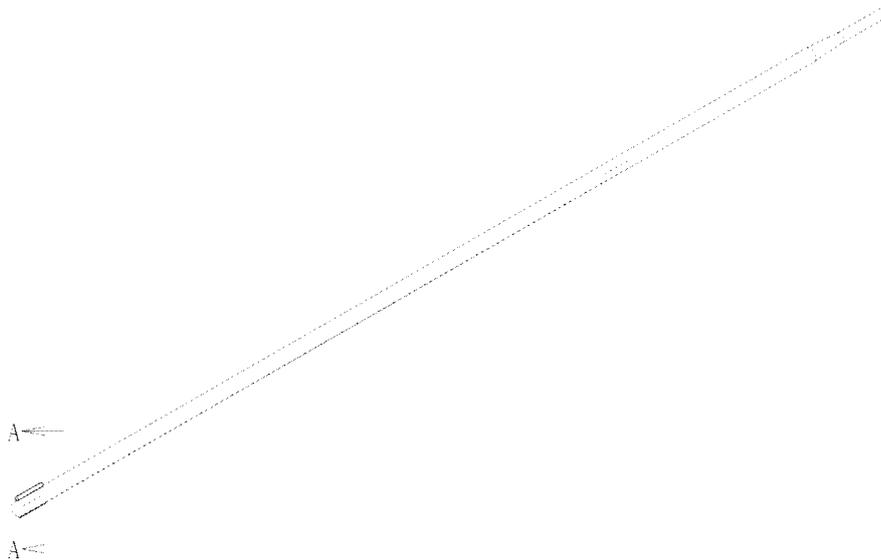
審查人員：黃少瑜

圖式數：9 共 4 頁

(54)名稱

基板處理裝置用氣體噴嘴之部分

代表圖：



【立體圖】



公告本

【設計說明書】

D236040

【中文設計名稱】基板處理裝置用氣體噴嘴之部分

【物品用途】

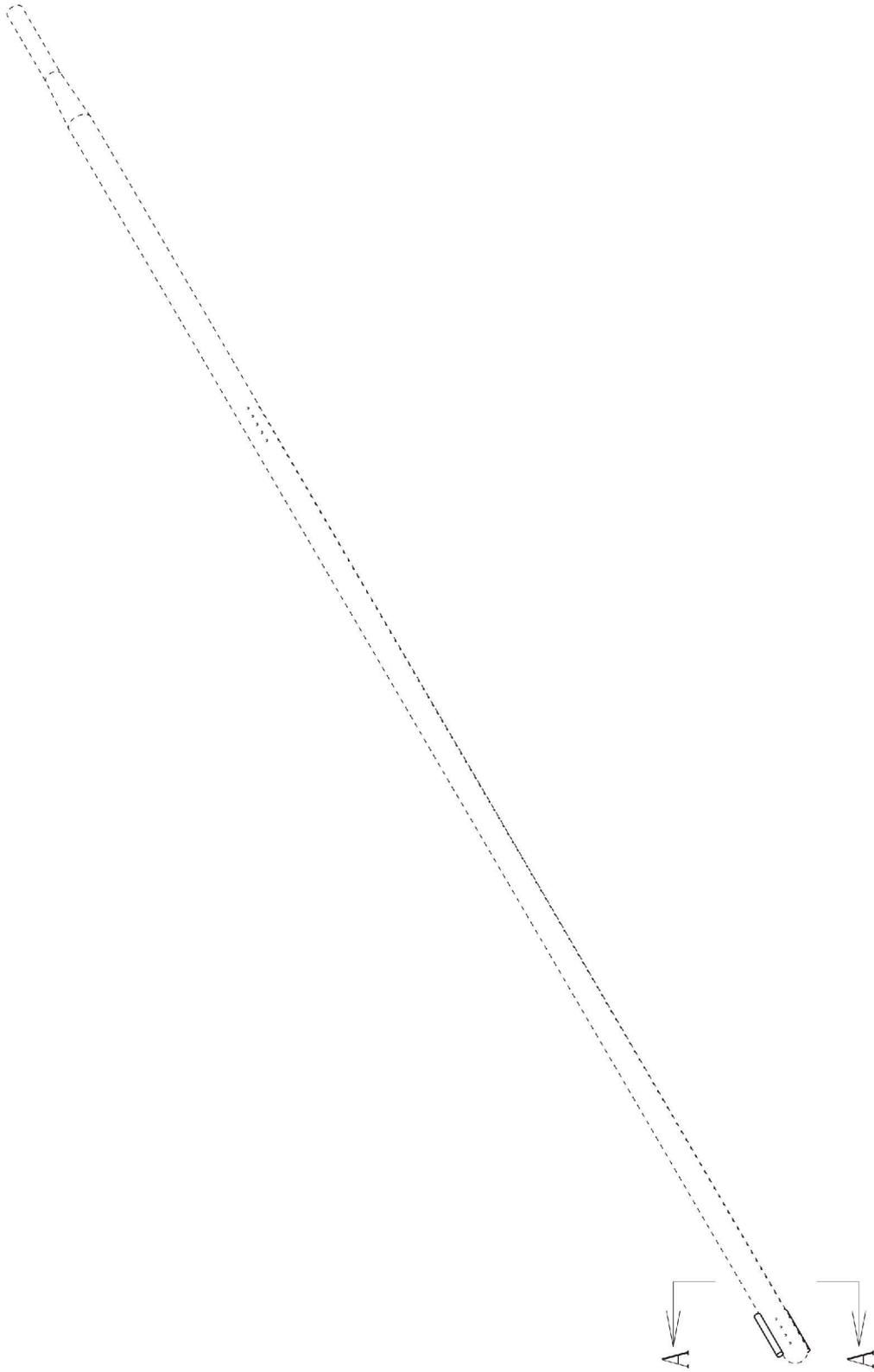
【0001】本設計之物品是基板處理裝置用氣體噴嘴，係使用在用來處理沿著垂直方向以多層保持在反應管內部的基板之基板處理裝置。

【設計說明】

【0002】本設計係在圓筒形的噴嘴之側壁，以同等間隔來設置氣體供應口。

【0003】圖式所揭露之虛線部分，為本案不主張設計之部分。

【設計圖式】
(指定代表圖)



【立體圖】



【前視圖】



【後視圖】



【俯視圖】



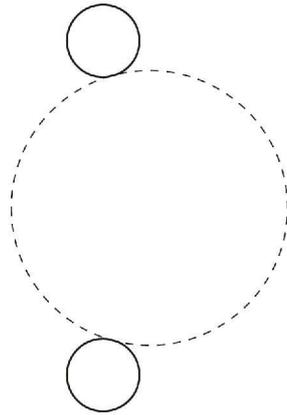
【仰視圖】



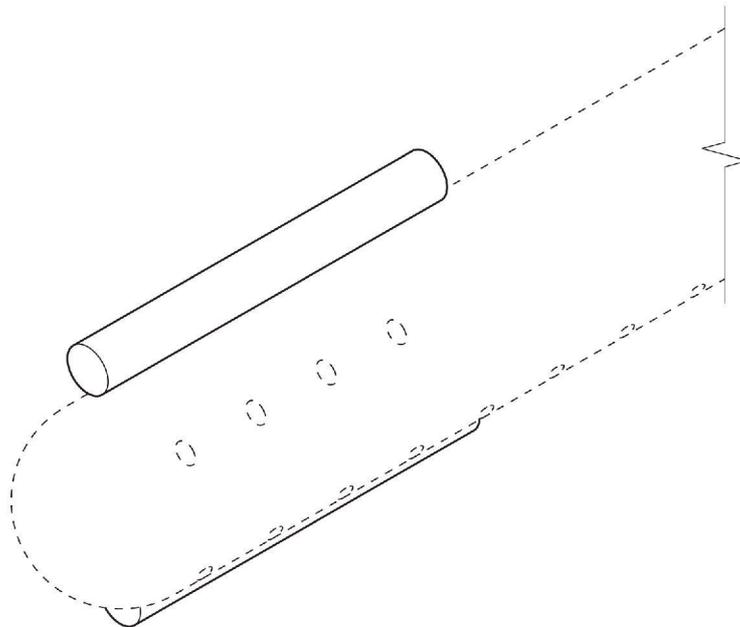
【左側視圖】



【右側視圖】



【放大左側視圖】



【A-A放大圖】